

마그네트론 스퍼터링에 의한 보론카바이드 증착막의 특성 Properties of Boron Carbide Thin Films Deposited by Magnetron Sputtering

충남대학교 재료공학과 이광은, 김종오
고기능성자성재료연구센터 김종희
(주)샘텍 기술연구소 이정영, 박명진, 이천배

1. 서론

최근 자기기록 매체의 발전에 힘입어 하드디스크(HDD)는 그 저장용량이 80GByte까지 증가하였으며, 고저장용량을 가진 하드디스크의 자성합금층 보호막으로 DLC가 이용되어 왔다. 고저장용량을 가지는 하드디스크 보호막의 두께가 점차 얇아짐에 따라 보호막 재료의 경도 및 윤활성이 더욱 중요시되고 있다. 그러나, 보호막의 두께가 감소하면서 현재 적용되고 있는 DLC막으로는 물리적 한계에 도달할 것으로 예상된다. 본 연구에서는 고밀도 자기기록매체인 하드디스크의 보호층으로 적용하기 위하여 boron carbide 증착막의 물리, 화학적 성질과 기계적 특성을 조사하였다.

2. 실험 방법

SiO₂/Si(100)기판 위에 CoCr/Cr막을 동일한 조건에서 증착함으로써 기판이 CoCr/Cr/SiO₂/Si의 다층구조를 가지도록 제작되었다. 자성막이 증착된 SiO₂/Si 기판상에 partially reactive sputtering 법을 사용하여 boron carbide를 코팅하였다. SEM과 XRD로 막의 미세구조 및 결정상을 관찰하고 XPS, EDS 및 AES에 의해 화학적 결합상태와 그 조성을 분석하였으며, 또한 scratch tester를 사용하여 막의 접착력을 측정하였다.

3. 실험 결과

Boron carbide 박막의 결정성은 증착온도에 크게 영향을 받았다. 박막을 구성하는 결정상들은 B₄C, B₈C 및 B₂₅C 이었으며, 실험범위 내에서 증착압력 및 기판온도에 상관없이 결정입자들의 크기는 거의 균일하였다. 반응가스인 CH₄의 주입량이 커질수록 박막 구성원소인 C 원소도 증가하였으며, 그에 비례하여 B 원소의 함량비는 감소하였다. B-B, C-C, B-C 결합이 모두 존재하였으며, 또한 시편의 공기흡착으로 인한 산소결합 peak가 약하게 관찰되었다. scratch tester에 의하여 임계하중을 측정한 결과, 증착온도가 높을수록 막의 접착성이 현저히 감소되었다.